

LSC-4000 - Очистка пластин и фотошаблонов

Применения:

Очистка

- Пластины
- Чипы на пластине
- Панели дисплеев
- Дисплеи с покрытием ITO оксид индия и олова
- Фотошаблоны с рисунком и без рисунка
- Заготовки фотошаблонов со слоем фоторезиста
- Фотошаблон для контактной литографии
- Очистка пластин после CMP

Фотолитография

- Удаление фоторезиста
- Нанесение фоторезиста
- Lift-Off

Травление

- Al, Au, Cr, Ti

Характеристики:

- 21" внешний диаметр, 15"x15" подложки
- Большая камера климатическая камера ультразвуковой очистки в DI (деионизованной воде), щеткой, горячая DI, деионизованная вода под высоким давлением, нагреваемый азот (N₂), рука с распылительным устройством химикатов
- Щетка с регулируемой скоростью с распылением химикатов
- Пользовательский интерфейс точскрин дисплеем
- Ручная загрузка/выгрузка
- Защитные блокировки и сигнализация
- Занимаемая площадь 30"Г x 26"Ш

Опции:

- Модуль доставки химикатов
- Piranha (пиранья) очистка
- Генератор озона
- Генератор DI воды с гидрогенизатором
- Модуль для DI воды высокого давления
- Серная кислота перекись водорода
- ИК нагрев
- Рециркулятор DI воды
- Модуль роботизированной загрузки/выгрузки



“ЭНЕРГОАВАНГАРД”

www.eavangard-semi.ru

e-mail:info@eavangard-semi.ru



Очистка Piranha

- H_2SO_4 и H_2O_2 распыление и смешивание на пластине
- ИК нагрев
- Щеточная очистка
- Ультразвуковая очистка DI водой
- Нагрев N_2 и центробежная сушка

Удаление фоторезиста / Lift Off

- NMP распыление с ИК нагревом
- Щеточная очистка
- Ультразвуковая очистка DI деионизованной водой
- Нагрев N_2 и центробежная сушка



Очистка пластин после химико-механического полирования (CMP)

- Снятие частиц после CMP щеткой и ультразвуковая очистка деионизованной водой
- Рука для распыления химикатов
- Емкости для распыления химикатов
- Специальные держатели для для щеточной очистки передней и задней сторон подложек
- Регулируемая скорость PVA щетки
- Регулируемая щетка / регулирование контактного давления щетки
- Распыление химикатов через щетку



Очистка фотошаблонов с покрытием и без него

- Полная очистка без необходимости снятия пленки
- Пленка полностью защищена
- Очистка фотошаблоны с пленкой:
 - 1) Очистка обратной стороны фотошаблона:
 - Ультразвуковая очистка DI водой
 - Очистка щеткой
 - Химическая очистка
 - Нагрев N_2 и центробежная сушка
 - 2) Очистка передней стороны совмещенного фотошаблона:
 - Ультразвуковая очистка DI водой
 - Дегкая очистка химикатами
 - 3) Нагрев N_2 и центробежная сушка

“ЭНЕРГОАВАНГАРД”